

Tab. 1

Základní prvky na povrchu a síla titan-oxidové vrstvy u pěti zkoumaných dentálních implantátů, vypočteno z intenzit XPS

Typ implantátu	Povrchová koncentrace (atom%) ¹								Síla vrstvy oxidů (nm)
	Ti	O	C	Si	Na	F	Cl	N	
Brånemark	12.8	51.9	29.8	—	5.0	—	0.5	—	5.7.
TPS	14.2	45.5	38.9	—	Stopové množství ²	Stopové množství ²	—	1.4.	5.5.
SLA	14.5	51.4	34.9	Stopové množství ²	—	—	—	1.3.	5.7.
ICE	0.9	21.1	71.9	6.1.	—	—	—	—	Neurčeno ³
Osseotite	6.8.	36.2	53.7	3.3.	Stopové množství ²	—	Stopové množství ²	5.4.	

¹U udaných hodnot je třeba počítat s relativní odchylkou $\pm 15\%$.

²Stopové množství: tyto prvky byly zjištěny v poměru signál-šum > 3 , ale intenzita je pro kvantifikaci příliš nízká.

³Určení nebylo možné, protože titan-oxidová vrstva byla skrytá pod vrchní povrchovou vrstvou složenou zejména z C, Si a O (viz text).